



①⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 101 31 779 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>7</sup>:  
**G 01 B 9/02**

②① Aktenzeichen: 101 31 779.4  
②② Anmeldetag: 3. 7. 2001  
④③ Offenlegungstag: 28. 2. 2002

DE 101 31 779 A 1

⑥⑥ Innere Priorität:  
100 33 028. 2      07. 07. 2000

⑦① Anmelder:  
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

⑦④ Vertreter:  
Jeck . Fleck . Herrmann Patentanwälte, 71665  
Vaihingen

⑦② Erfinder:  
Erfinder wird später genannt werden

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Interferometrische Messvorrichtung

⑤⑦ Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung einer Fläche (A) eines Objektes (BO) mit einer eine kurzkohärente Strahlung abgebenden Strahlungsquelle (KL), einem Strahlteiler (ST) zum Bilden eines über einen Objektlichtweg (OW) zu dem Objekt (BO) geleiteten Objektstrahls und eines über einen Referenzlichtweg (RW) zu einer reflektierenden Referenzebene (SP1) geleiteten Referenzstrahls und mit einem Bildwandler (BW), der die von der Fläche (A) und der Referenzebene (SP1) zurück geworfene und zur Interferenz gebrachte Strahlung aufnimmt und einer Auswerteeinrichtung zum Bestimmen eines die Fläche (A) betreffenden Messergebnisses zuführt, wobei zum Auswerten des Interferenzmaximums die optische Länge des Objektlichtweges (OW) relativ zu der optischen Länge des Referenzlichtweges (RW) geändert wird. Bei einfacher Justierung wird eine genaue Messung räumlich voneinander getrennter Oberflächen dadurch erreicht, dass in dem Objektlichtweg (OW) eine Superpositionsoptik mit einer Multifokaloptik (LB) oder einer Freie-Segmente-Optik (FO) aus verschiedenen Abbildungselementen vorgesehen ist, dass mit der Superpositionsoptik gleichzeitig außer von der Fläche (A) von mindestens einer weiteren Fläche (B) ein Bild erzeugbar ist, das direkt oder über mindestens eine Zwischenabbildung auf dem Bildwandler (BW) abgebildet wird und dass die Auswertung der der Fläche (A) und der der mindestens einen weiteren Fläche (B) entsprechenden ...

DE 101 31 779 A 1

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung einer Fläche eines Objektes mit einer kurzkohärenten Strahlung abgebenden Strahlungsquelle, einem Strahlteiler zum Bilden eines über einen Objektlichtweg zu dem Objekt geleiteten Objektstrahls und eines über einen Referenzlichtweg zu einer reflektierenden Referenzebene geleiteten Referenzstrahls und mit einem Bildwandler, der die von der Fläche und der Referenzebene zurück geworfene und zur Interferenz gebrachte Strahlung aufnimmt und einer Auswerteeinrichtung zum Bestimmen eines die Fläche betreffenden Messergebnisses zuführt, wobei für die Messung die optische Länge des Objektlichtweges relativ zu der optischen Länge des Referenzlichtweges geändert wird.

## Stand der Technik

[0002] Eine interferometrische Messvorrichtung dieser Art ist in der DE 41 08 944 A1 angegeben (wobei die vorliegend alternativ noch angegebene Zwischenbildabtastung jedoch nicht genannt ist). Bei dieser bekannten interferometrischen Messvorrichtung, die auf dem Messprinzip der sogenannten Weisslichtinterferometrie oder Kurzkohärenzinterferometrie beruht, gibt eine Strahlungsquelle kurzkohärente Strahlung ab, die über einen Strahlteiler in einen ein Messobjekt beleuchtenden Objektstrahl und einen eine reflektierende Referenzebene in Form eines Referenzspiegels beleuchtenden Referenzstrahl aufgeteilt wird. Um die Objektoberfläche in Tiefenrichtung abzutasten, wird der Referenzspiegel mittels eines Piezostellelementes in Richtung der optischen Achse des Referenzlichtweges verfahren. Wenn der Objektlichtweg und der Referenzlichtweg übereinstimmen, ergibt sich im Bereich der Kohärenzlänge ein Maximum des Interferenzkontrastes, der mittels eines photoelektrischen Bildwandlers und einer nachgeschalteten Auswerteeinrichtung erkannt und zur Bestimmung der Kontur der Objektoberfläche auf der Grundlage der bekannten Auslenkposition des Referenzspiegels ausgewertet wird.

[0003] Weitere derartige interferometrische Messvorrichtungen bzw. interferometrische Messverfahren auf der Basis der Weisslichtinterferometrie sind in P. de Groot, L. Deck, "Surface profiling by analysis of white-light interferograms in the spatial frequency domain" J. Mod. Opt., Vol. 42, No. 2, 389-401, 1995 und Th. Dresel, G. Häusler, H. Venzke; "Three-dimensional sensing of rough surfaces by coherence radar", Appl. Opt., Vol. 31, No. 7, 919-925, 1992 angegeben.

[0004] In der (nicht vorveröffentlichten) deutschen Patentanmeldung 199 48 813 ist ebenfalls eine derartige interferometrische Messvorrichtung auf der Basis der Weisslichtinterferometrie gezeigt, wobei insbesondere zur Messung in engen Hohlräumen die laterale Auflösung vergrößert wird, indem im Objektlichtweg ein Zwischenbild erzeugt wird. In der ebenfalls nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmeldung 100 15 878.1 ist vorgeschlagen, zur Vergrößerung der Schärfentiefe bei gleichzeitig relativ großer lateraler Auflösung eine Zwischenbildabtastung durchzuführen.

[0005] Bei den bekannten interferometrischen Messvorrichtungen bzw. Messverfahren bestehen Schwierigkeiten, wenn die Messaufgabe die Abtastung mehrerer voneinander getrennter Flächen erfordert, die z. B. mehrere Millimeter beabstandet und/oder schräg zueinander orientiert sind.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine interferometrische Messvorrichtung der eingangs genannten Art bereit zu stellen, mit der mindestens zwei voneinander

räumlich getrennte Flächen mit möglichst geringem Aufwand mit genauen, gut reproduzierbaren Messergebnissen vermessen werden können.

## Vorteile der Erfindung

[0007] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und alternativ 3 gelöst. Hiernach ist vorgesehen, dass in dem Objektlichtweg eine Superpositionsoptik mit einer Multifokaloptik oder einer Freie-Segmente-Optik aus verschiedenen Abbildungselementen vorgesehen ist, dass mit der Superpositionsoptik gleichzeitig außer von der Fläche von mindestens einer weiteren Fläche ein Bild erzeugbar ist, die direkt oder über mindestens eine Zwischenabbildung im Objektlichtweg auf dem Bildwandler abgebildet werden und dass die Messung der Fläche und der mindestens einen weiteren Fläche unter relativer Änderung der optischen Länge des Objektlichtweges zu der optischen Länge des Referenzlichtweges (Abtasten, Scan) erfolgt. Alternativ ist vorgesehen, dass in dem Objektlichtweg eine Abbildungsoptik mit einer Schärfentiefe von mindestens dem optischen Wegunterschied der beiden Flächen vorgesehen ist, mit der gleichzeitig außer von der Fläche von mindestens einer davor oder dahinter liegenden, parallelen weiteren Fläche – oder über optische Ablenkelemente schräg oder rechtwinklig zueinander angeordneten Flächen – ein Bild erzeugbar ist, das über mindestens eine Zwischenabbildung im Objektlichtweg auf dem Bildwandler abgebildet wird und dass die Messung der Fläche und der mindestens einen weiteren Fläche unter relativer Änderung der optischen Länge des Objektlichtweges zu der optischen Länge des Referenzlichtweges erfolgt.

[0008] Mit diesen Maßnahmen wird ohne neue Justierung des Objektlichtweges eine genaue Messung der unterschiedlichen Flächen ermöglicht. Zur Erfassung des Referenzmaximums müssen lediglich die optischen Längen des Referenzlichtweges und des Objektlichtweges entsprechend den Lagen der verschiedenen Flächen nacheinander eingestellt werden. Die Freie-Segmente-Optik lässt sich dabei z. B. auch leicht an schräg zueinander gestellte oder gegenüberliegende Flächen anpassen. Mit der Multifokaloptik und auch mit der eine Schärfentiefe von mindestens dem optischen Wegunterschied der beiden Flächen aufweisenden Abbildungsoptik lassen sich unterschiedlich weit voneinander entfernte und unterschiedlich zueinander orientierte Flächen und auch z. B. deren Parallelität oder Planheit, Dicke und Durchmesser vermessen.

[0009] Verschiedene günstige Ausgestaltungen bestehen weiterhin darin, dass der Objektlichtweg zum Erzeugen eines gemeinsamen Zwischenbildes der Fläche und des Zwischenbildes der weiteren Fläche(n) in einer gemeinsamen Zwischenbildebene im Objektlichtweg ausgebildet ist und dass das gemeinsame Zwischenbild direkt oder über mindestens eine Zwischenabbildung auf dem Bildwandler abgebildet wird. Mit mindestens einer Zwischenabbildung ist zum einen eine Zwischenbildabtastung und zum anderen eine erhöhte laterale Auflösung möglich.

[0010] Eine Messung mit relativ großer lateraler Auflösung auch in engen Hohlräumen lässt sich einfach durchführen, wenn vorgesehen ist, dass der Objektlichtweg als Endoskop ausgebildet ist.

[0011] Für eine genaue Messung sind weiterhin die Maßnahmen vorteilhaft, dass zur Beleuchtung des Objektes mit einer ebenen Welle ein Lichtwellenleiter vorgesehen ist, deren objektseitiger Ausgang in eine telezentrische Abbildungsanordnung des Objektlichtweges gelegt ist, oder dass ein Beleuchtungslichtweg mit zusätzlichen Linsen und Ablenkelementen gebildet ist.

[0012] Die Messung wird dadurch ermöglicht oder weiterhin begünstigt, dass der Referenzlichtweg dem Objektlichtweg ähnliche oder identische Optiken aufweist, durch welche die Erzeugung der Interferenzen ermöglicht wird oder der Interferenzkontrast optimiert wird oder optische Einflüsse der Komponenten im Objektlichtweg kompensiert werden.

[0013] Vielfältige Möglichkeiten, auf einfache Weise verschiedene Oberflächen auch an schwer zugänglichen Stellen zu vermessen, ergeben sich dadurch, dass im Objektlichtweg eine bezüglich des Objekts starre Optik angeordnet ist und dass der starren Optik eine in Richtung ihrer optischen Achse bewegliche Optik folgt.

[0014] Eine günstige Ausbildung für den Aufbau und die Handhabung besteht darin, dass die starre Optik Teil der Superpositionsoptik ist.

[0015] Zum Erreichen einer gegen laterale Relativbewegung des Objektes robusten Messung ist es vorteilhaft vorgesehen, dass die starre Optik nach Unendlich abbildet.

[0016] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung besteht desweiteren darin, dass die starre Optik als Superpositionsoptik ausgebildet ist, mit der mindestens ein zum Objekt starres Zwischenbild erzeugt wird, und dass als bewegliche Optik eine im Strahlengang hinter dem starren Zwischenbild folgende Objektiv-Optik in Richtung ihrer optischen Achse beweglich zur Abtastung des normal zu dieser Achse ausgerichteten Zwischenbilds in Tiefenrichtung und Abbilden desselben direkt oder über eine oder mehrere Zwischenabbildungen auf dem Bildwandler ausgebildet ist. Durch die Erzeugung des z. B. im Objektlichtweg liegenden starren Zwischenbilds der Objektoberfläche mit der Superpositionsoptik in dem Objektlichtweg wird auch in engen Kanälen oder Bohrungen die zu messende Objektoberfläche mit relativ großer lateraler Auflösung erfassbar und mit dem Bildwandler und der nachgeschalteten Auswerteeinrichtung hinsichtlich der Tiefenstruktur auswertbar. Die Abtastung des starren Zwischenbildes ist mit relativ einfachen Maßnahmen möglich, da zu seiner Tiefenabtastung nur wenige optische Komponenten des Objektlichtweges bewegt werden müssen, wobei die jeweils abgetastete Tiefe des starren Zwischenbildes stets im Schärfiefenbereich der beweglichen Objektivoptik bleibt, da durch die Tiefenabtastung (Tiefenscan) die Objektebene der bewegten Objektivoptik gleichsam durch das starre Zwischenbild hindurch bewegt wird und auf diese Weise z. B. die Interferenzmaxima im Bereich größter Schärfentiefe ausgewertet werden.

[0017] Die Abbildungsqualität und Genauigkeit der Auswertung wird dadurch begünstigt, dass die Zwischenabbildung für alle im Zwischenbild abgebildeten Objektpunkte gleichen Abbildungsmaßstab besitzt. Beispielsweise kann dabei der Aufbau derart sein, dass die starre Optik als 4f-Anordnung ausgebildet ist.

[0018] Bezüglich der Ausbildung der starren Optik und der beweglichen Optik sei ergänzend auf die deutsche Patentanmeldung Nr. 101 15 524 derselben Anmelderin hingewiesen.

### Zeichnung

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer interferometrischen Messvorrichtung nach dem Prinzip der Weisslichtinterferometrie (Kurzkohärenzinterferometrie) mit einer Freie-Segmente-Optik, wobei die Freie-Segmente-Optik in zwei um 90° zueinander gedrehten Lagen dargestellt ist, [0021] Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel der inter-

ferometrischen Messvorrichtung, wobei in dem Objektlichtweg eine Superpositionsoptik mit getrennten Linsenelementen gebildet ist,

[0022] Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine interferometrische Messvorrichtung, wobei in dem Objektlichtweg eine Bifokaloptik angeordnet ist,

[0023] Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer interferometrischen Messvorrichtung, bei dem die Strahlung in dem Referenzlichtweg und dem Objektlichtweg mit Lichtwellenleitern geführt wird und

[0024] Fig. 5 ein weiteres Ausführungsbeispiel der interferometrischen Messvorrichtung, bei dem die Strahlung in dem Objektlichtweg über einen Beleuchtungslichtweg mit Linsen und Ablenkelementen geführt wird.

### Ausführungsbeispiel

[0025] Wie Fig. 1 zeigt, weist eine auf dem Prinzip der Weisslichtinterferometrie (Kurzkohärenzinterferometrie) beruhende interferometrische Messvorrichtung einen Objektlichtweg OW, einen Referenzlichtweg RW und einen Bildwandler BW mit nachgeschalteter Auswerteeinrichtung auf, wie an sich bekannt und in den einleitend genannten Druckschriften sowie darin genannter Literatur näher beschrieben. Dabei wird ausgenutzt, dass Interferenz nur im Bereich der Kohärenzlänge auftritt, wodurch eine einfache Abstimmung der optischen Weglängen des Referenzlichtweges RW und des Objektlichtweges OW sowie z. B. die Erfassung des Interferenzmaximums ermöglicht wird. EiÄe von einer kurzkohärenten Lichtquelle KL abgegebene Strahlung hat dabei z. B. eine Kohärenzlänge in der Größenordnung von 10 µm. Die Strahlung der kurzkohärenten Lichtquelle KL wird mittels eines Strahlteilers ST in einen über den Referenzlichtweg RW geführten Referenzstrahl und einen über den Objektlichtweg OW geführten Objektstrahl aufgeteilt. In dem Lichtweg zu dem Bildwandler BW sind für die Abbildung vorliegend eine vierte und eine fünfte Linse L4, L5 angeordnet.

[0026] Die Messung wird dadurch ermöglicht oder weiterhin begünstigt, dass der Referenzlichtweg dem Objektlichtweg ähnliche oder identische Optiken aufweist, durch welche die Erzeugung der Interferenzen ermöglicht wird oder der Interferenzkontrast optimiert wird oder optische Einflüsse der Komponenten im Objektlichtweg kompensiert werden.

[0027] In dem Objektlichtweg OW ist als weitere Besonderheit eine Superpositionsoptik in Form einer Freie-Segmente-Optik FO angeordnet, die in den rechts daneben gezeigten Darstellungen im Querschnitt (obere Darstellung) in einer 0°-Ansicht (mittlere Darstellung) und in einer 90°-Ansicht (untere Darstellung) in einem in eine Ventilbohrung BO bis in die Nähe eines Ventilsitzes VS geführten Zustand wiedergegeben ist. Mit der Freien-Segmente-Optik FO können gleichzeitig mehrere voneinander getrennte Flächen A, B der Bohrung BO bzw. des Ventilsitzes VS erfasst und in einem gemeinsamen Zwischenbild ZW in einer Zwischenbildebene im Objektlichtweg abgebildet werden, die senkrecht zu einer optischen Hauptachse des Objektlichtweges OW liegt. Die Freie-Segmente-Optik FO besitzt mehrere Licht ablenkende Flächen und abbildende Linsenelemente und ist an die jeweilige Messanforderung angepasst. Insbesondere können unterschiedlich weit von dem gemeinsamen Zwischenbild ZW entfernte und auch schräg zueinander gerichtete oder gegenüberliegende Flächen A, B erfasst und in dem gemeinsamen Zwischenbild ZW abgebildet werden.

[0028] Die Erfassung der den beiden Flächen A, B entsprechenden Interferenzmaxima erfolgt durch Änderung des Referenzlichtweges RW entsprechend einer Abtastrichtung

r. Die bewegte Einheit ist strichliert dargestellt.

[0029] Die in dem Objektlichtweg OW angeordnete Superpositionsoptik weist zwei parallel geschaltete Linsen, nämlich eine erste Linse L1 und eine zweite Linse L2 mit verschiedenen Brennweiten auf, denen prismenförmige Elemente vorgeschaltet sein können. Der Objektlichtweg ist außerdem zum Erzeugen einer telezentrischen Abbildung ausgelegt. Mit den beiden Linsen L1 und L2 werden unterschiedlich weit, z. B. einige  $\mu\text{m}$  bis über 1 cm voneinander entfernte, parallel zueinander und senkrecht zur optischen Hauptachse des Objektlichtweges OW liegende Flächen A, B in das gemeinsame Zwischenbild ZW aus dem Zwischenbild ZA der Fläche A und dem Zwischenbild ZB der Fläche B in einer Zwischenbildebene im Objektlichtweg abgebildet. Die Brennweiten der ersten und der zweiten Linse L1, L2 sind mit  $F_A$ ,  $F_B$  angegeben. In dem Strahlengang des Objektlichtweges OW ist weiterhin eine dritte Linse L3 zur Abbildung angeordnet. Zum Erfassen des Interferenzmaximums wird der Spiegel SP in Abstrichtung r bewegt.

[0030] In Fig. 3 ist ein Ausführungsbeispiel der interferometrischen Messvorrichtung gezeigt, bei dem gegenüber der Fig. 2 anstelle der beiden Linsen L1, L2 eine Bifokalloptik LB angeordnet ist, deren Eigenschaft in etwa den beiden Linsen L1, L2 entspricht.

[0031] Bei dem in Fig. 4 angegebenen Ausführungsbeispiel sind in den Strahlengang des Objektlichtweges der Bifokalloptik LB objektseitig gelegene weitere Linsen L6, L7 eingebracht. In dem Objektlichtweg OW liegt außerdem ein Lichtwellenleiter LL, über den die kurzkohärente Strahlung von der Strahlungsquelle KL geführt wird, um die Flächen A, B über die weitere Linse L7 mit einer ebenen Wellenfront zu beleuchten. Im Wesentlichen entsprechende Linsen sind auch in den Referenzlichtweg RW zur Kompensation angeordnet, und auch in dem Objektlichtweg wird die Strahlung über einen Lichtwellenleiter zugeführt.

[0032] In Fig. 5 ist gegenüber der Fig. 4 in dem Objektlichtweg OW der Lichtwellenleiter LL durch einen Beleuchtungslichtweg LW mit diskreten zusätzlichen Linsen LZ1, LZ2 und Ablenkelementen AE1, AE2 ersetzt, um die Flächen A, B mit einer ebenen Welle zu beleuchten. Die weiteren Linsen L6, L7 sind dabei nicht vorgesehen.

[0033] Mit den vorstehend angegebenen interferometrischen Messvorrichtungen werden unter Verwendung von Sonderoptiken in Form der genannten Superpositionsoptiken gleichzeitig die räumlich voneinander getrennten Flächen A, B vermessen. Dabei können z. B. Abstand bzw. Dicke, Parallelität und Durchmesser der räumlich getrennten Flächen A, B gemessen werden. Die räumlich getrennten Flächen können direkt oder über ein gemeinsames Zwischenbild ZW im Objektlichtweg auf den Bildwandler BW abgebildet werden.

[0034] Das gemeinsame Zwischenbild ZW kann direkt oder über eine oder mehrere Zwischenabbildungen im Objektlichtweg auf dem Bildwandler BW z. B. einer CCD-Kamera abgebildet werden.

[0035] Der Aufbau der interferometrischen Messvorrichtung ist z. B. als Michelson-Interferometer realisiert. Die kurzkohärente Strahlungsquelle KL ist z. B. eine Superlumineszenzdiode oder eine Leuchtdiode. Mit der Beleuchtung durch die Superpositionsoptik werden die räumlich getrennten Flächen A, B des Objektes beleuchtet, wobei es günstig ist, die getrennten Flächen A, B mit nahezu ebenen Wellen zu beleuchten.

[0036] Die Superpositionsoptik in Form der Freie-Segmente-Optik FO kann z. B. aus verschiedenen einzelnen Linsensystemen bestehen, die unterschiedliche Flächen entlang unterschiedlicher optischer Achsen und mit unterschiedlichen optischen Weglängen in die gemeinsame Zwi-

schenbildebene abbilden. Die Freie-Segmente-Optik FO kann mit optischen Elementen, wie z. B. sphärischen Linsen, asphärischen Linsen, Stablinsen oder Grin-Linsen oder mit diffraktiven optischen Elementen oder Prismen oder Spiegeln realisiert werden, die miteinander kombiniert sein können.

[0037] Anstelle der Ausbildung der Superpositionsoptik als Bifokalloptik LB kann auch eine Multifokalloptik verwendet werden, wenn mehr Flächen vermessen werden sollen. Die Multifokalloptik kann z. B. mit einer weiteren Linse zu einer telezentrischen Anordnung kombiniert werden.

[0038] Zum Abgleich der optischen Weglängen und der Dispersion in beiden Interferometerarmen, nämlich dem Referenzlichtweg RW und dem Objektlichtweg OW, sollten die Faserlängen und Geometrien der verwendeten Lichtwellenleiter möglichst identisch gewählt werden.

[0039] Die Superpositionsoptik kann näherungsweise auch durch eine Optik mit großer Schärfentiefe oder mit erweiterter Schärfentiefe, z. B. Axicon, realisiert werden.

[0040] Im Falle einer Multifokalloptik bzw. Bifokalloptik als Superpositionsoptik kann zur Kompensation in dem Referenzlichtweg RW eine Optik mit nur einer Brennebene eingesetzt werden, wie aus Fig. 3 ersichtlich.

[0041] Auf dem Bildwandler BW wird ein mit der Referenzwelle überlagertes Bild der zu betrachtenden Flächen A, B erzeugt. Zur Datenauswertung erfolgt z. B. eine durch die Abtastbewegung r bewirkte Änderung des Gangunterschiedes zwischen den optischen Weglängen im Objekt- und Referenzlichtweg (Tiefenscan). Es können entsprechend dem Stand der Technik verschiedene Vorgehensweisen zur Änderung des Gangunterschiedes vorgesehen sein, z. B. Bewegung des Referenzspiegels, Bewegung des Objektes in Tiefenrichtung, Bewegung des Objektivs in Tiefenrichtung, Bewegung des gesamten Sensors relativ zu dem Objekt oder auch eine Zwischenbildabtastung gemäß der deutschen Patentanmeldung 100 15 878 oder eine Änderung der optischen Weglänge durch akustooptische Modulatoren.

[0042] Im Bild des Objektes tritt hoher Interferenzkontrast dann auf, wenn der Gangunterschied in beiden Interferometerarmen kleiner als die Kohärenzlänge ist. Zur Gewinnung des 3D-Höhenprofils haben sich verschiedene Verfahren etabliert. Sie beruhen darauf, dass während der Tiefenabtastung für jeden Bildpunkt (Pixel) der Gangunterschied detektiert wird, bei welchem der höchste Interferenzkontrast auftritt.

#### Patentansprüche

1. Interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung einer Fläche (A) eines Objektes (BO) mit einer kurzkohärenten Strahlung abgebenden Strahlungsquelle (KL), einem Strahlteiler (ST) zum Bilden eines über einen Objektlichtweg (OW) zu dem Objekt (BO) geleiteten Objektstrahls und eines über einen Referenzlichtweg (RW) zu einer reflektierenden Referenzebene (SP1) geleiteten Referenzstrahls und mit einem Bildwandler (BW), der die von der Fläche (A) und der Referenzebene (SP1) zurück geworfene und zur Interferenz gebrachte Strahlung aufnimmt und einer Auswerteinrichtung zum Bestimmen eines der Fläche (A) betreffenden Messergebnisses zuführt, wobei für die Messung die optische Länge des Objektlichtweges (OW) relativ zu der optischen Länge des Referenzlichtweges (RW) geändert wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass in dem Objektlichtweg (OW) eine Superpositionsoptik mit einer Multifokalloptik (LB) oder einer Freie-Segmente-Optik (FO) aus verschiedenen Abbildungselementen vorgesehen ist,

dass mit der Superpositionsoptik gleichzeitig außer von der Fläche (A) von mindestens einer weiteren Fläche (B) ein Bild erzeugbar ist, die direkt oder über mindestens eine Zwischenabbildung im Objektlichtweg auf dem Bildwandler (BW) abgebildet werden und dass die Messung der Fläche (A) und der mindestens einen weiteren Fläche (B) unter relativer Änderung der optischen Länge des Objektlichtweges zu der optischen Länge des Referenzlichtweges erfolgt.

2. Messvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Freie-Segmente-Optik (FO) zum Aufnehmen von schräg zueinander orientierten Flächen (A, B) ausgebildet ist.

3. Interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung einer Fläche (A) eines Objektes (BO) mit einer kurzkohärenten Strahlung abgebenden Strahlungsquelle (KL), einem Strahlteiler (ST) zum Bilden eines über einen Objektlichtweg (OW) zu dem Objekt (BO) geleiteten Objektstrahls und eines über einen Referenzlichtweg (RW) zu einer reflektierenden Referenzebene (SP1) geleiteten Referenzstrahls und mit einem Bildwandler (BW), der die von der Fläche (A) und der Referenzebene (SP1) zurück geworfene und zur Interferenz gebrachte Strahlung aufnimmt und einer Auswerteeinrichtung zum Bestimmen eines die Fläche (A) betreffenden Messergebnisses zuführt, wobei für die Messung die optische Länge des Objektlichtweges (OW) relativ zu der optischen Länge des Referenzlichtweges (RW) geändert wird, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Objektlichtweg (OW) eine Abbildungsoptik mit einer Schärfentiefe von mindestens dem optischen Wegunterschied der beiden Flächen vorgesehen ist, mit der gleichzeitig außer von der Fläche (A) von mindestens einer davor oder dahinter liegenden, parallelen weiteren Fläche (B) – oder über optische Ablenkelemente schräg oder rechtwinklig zueinander angeordneten Flächen – ein Bild erzeugbar ist, das über mindestens eine Zwischenabbildung im Objektlichtweg auf dem Bildwandler (BW) abgebildet wird und dass die Messung der Fläche (A) und der mindestens einen weiteren Fläche (B) unter relativer Änderung der optischen Länge des Objektlichtweges zu der optischen Länge des Referenzlichtweges erfolgt.

4. Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Objektlichtweg (OW) zum Erzeugen eines gemeinsamen Zwischenbildes (ZW) eines Zwischenbildes der Fläche (A) und eines Zwischenbildes der weiteren Fläche (B) in einer gemeinsamen Zwischenbildebene im Objektlichtweg ausgebildet ist und dass das gemeinsame Zwischenbild (ZW) direkt oder über mindestens eine Zwischenabbildung auf dem Bildwandler (BW) abgebildet wird.

5. Messvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Abtastung des gemeinsamen Zwischenbildes (ZW) erfolgt.

6. Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Objektlichtweg (OW) als Endoskop ausgebildet ist.

7. Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Beleuchtung des Objektes (BO, VS) mit einer ebenen Welle ein Lichtwellenleiter (LL) vorgesehen ist, deren objektseitiger Ausgang in eine telezentrische Abbildungsanordnung des Objektlichtweges (OW) gelegt ist, oder dass ein Beleuchtungslichtweg (LW) mit zusätzlichen Linsen (LZ1, LZ2) und Ablenkelementen (AE1, AE2)

gebildet ist.

8. Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Referenzlichtweg (RW) dem Objektlichtweg (OW) ähnliche oder identische Optiken aufweist.

9. Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Objektlichtweg (OW) eine bezüglich des Objekts (30) starre Optik angeordnet ist und dass der starren Optik eine in Richtung ihrer optischen Achse bewegliche Optik (BO) folgt.

10. Messvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die starre Optik Teil der Superpositionsoptik ist.

11. Messvorrichtung nach Anspruch oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die starre Optik nach Unendlich abbildet.

12. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die starre Optik als Superpositionsoptik ausgebildet ist, mit der mindestens ein zum Objekt (BO) starres Zwischenbild erzeugt wird, und dass als bewegliche Optik eine im Strahlengang hinter dem starren Zwischenbild folgende Objektiv-Optik in Richtung ihrer optischen Achse beweglich zur Abtastung des normal zu dieser Achse ausgerichteten Zwischenbilds in Tiefenrichtung und Abbilden desselben direkt oder über eine oder mehrere Zwischenabbildungen auf dem Bildwandler (BW) ausgebildet ist.

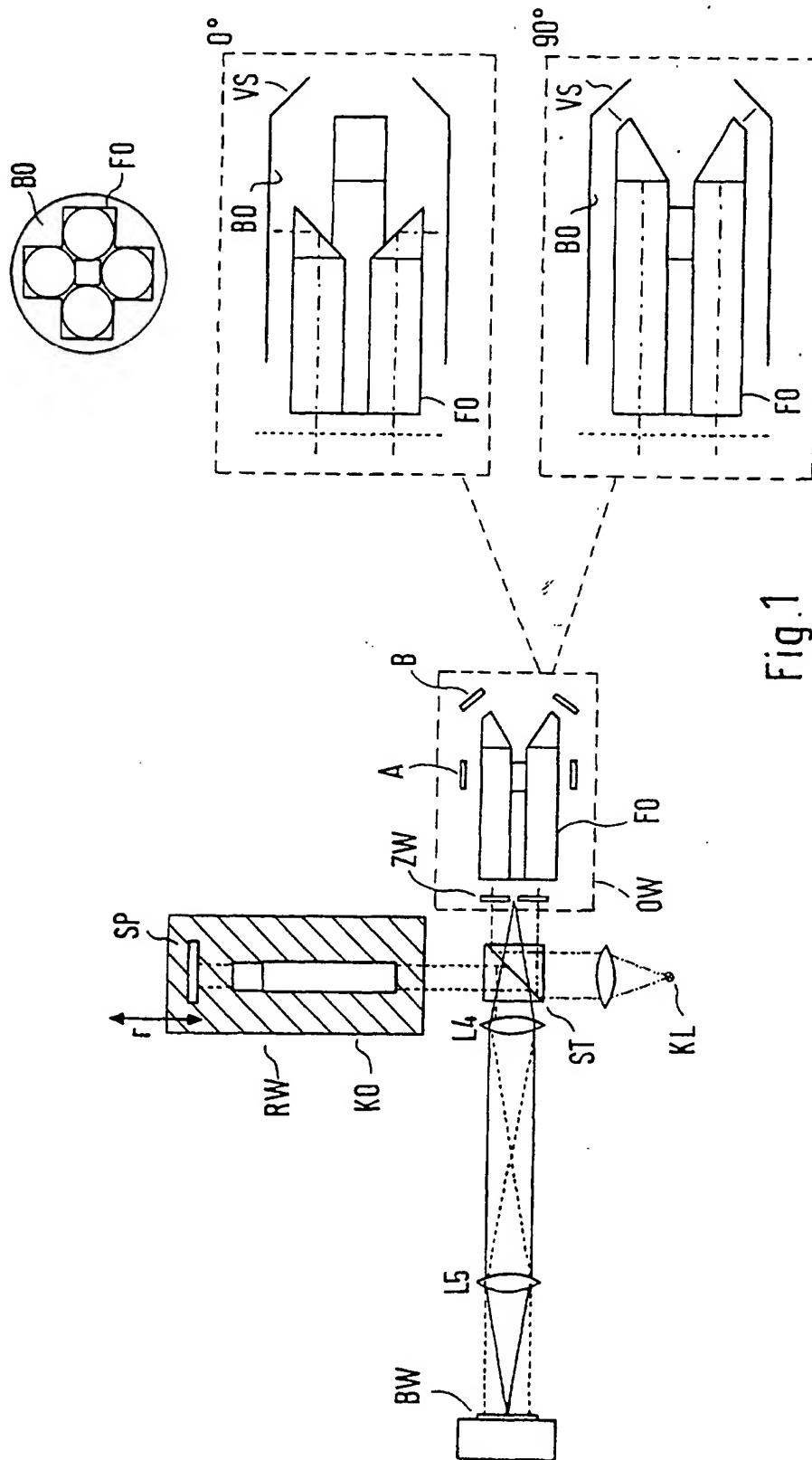
13. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenabbildung für alle im Zwischenbild (ZW) abgebildeten Objektpunkte gleichen Abbildungsmaßstab besitzt.

14. Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die starre Optik als 4f-Anordnung ausgebildet ist.

---

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

---



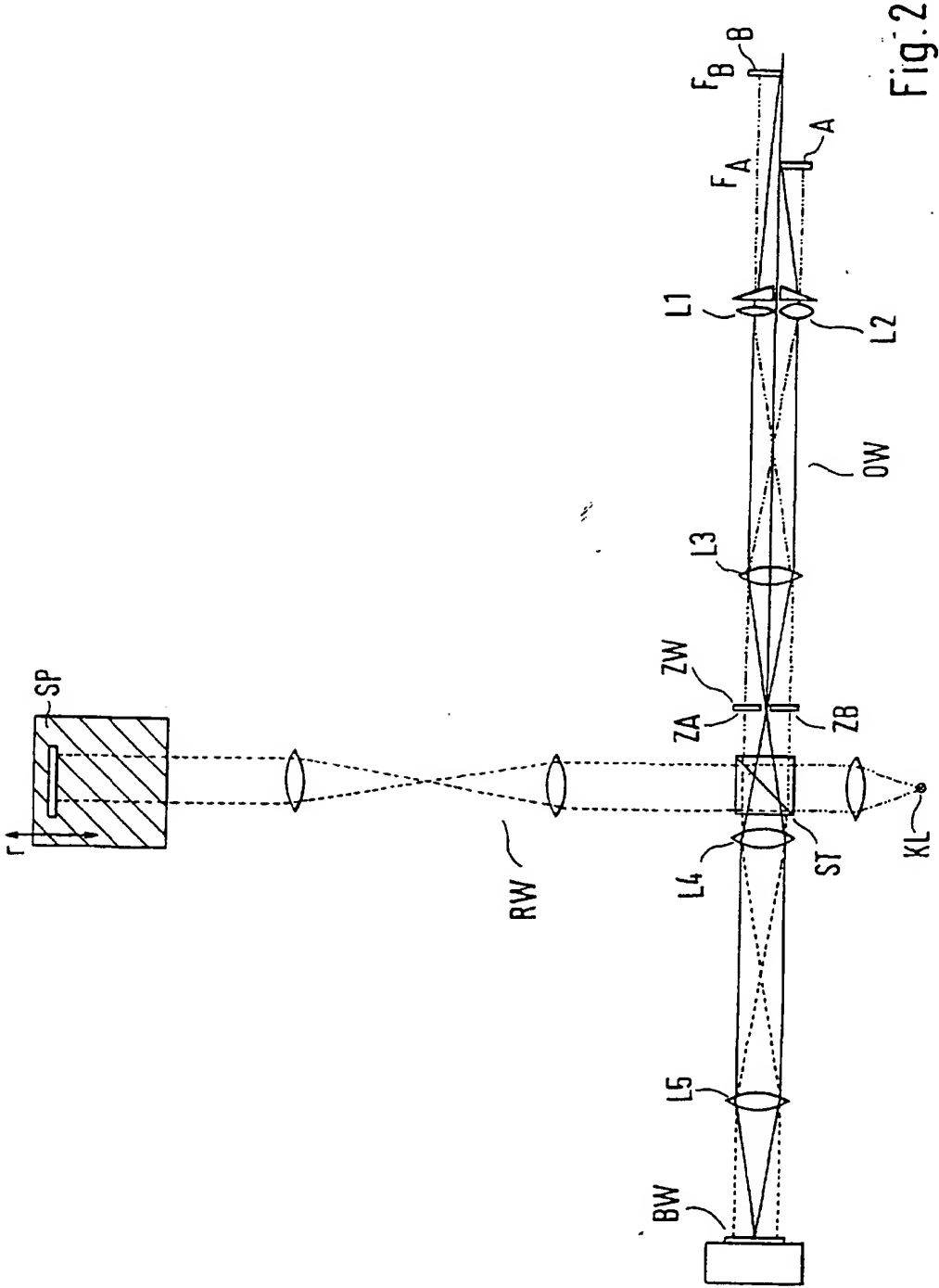
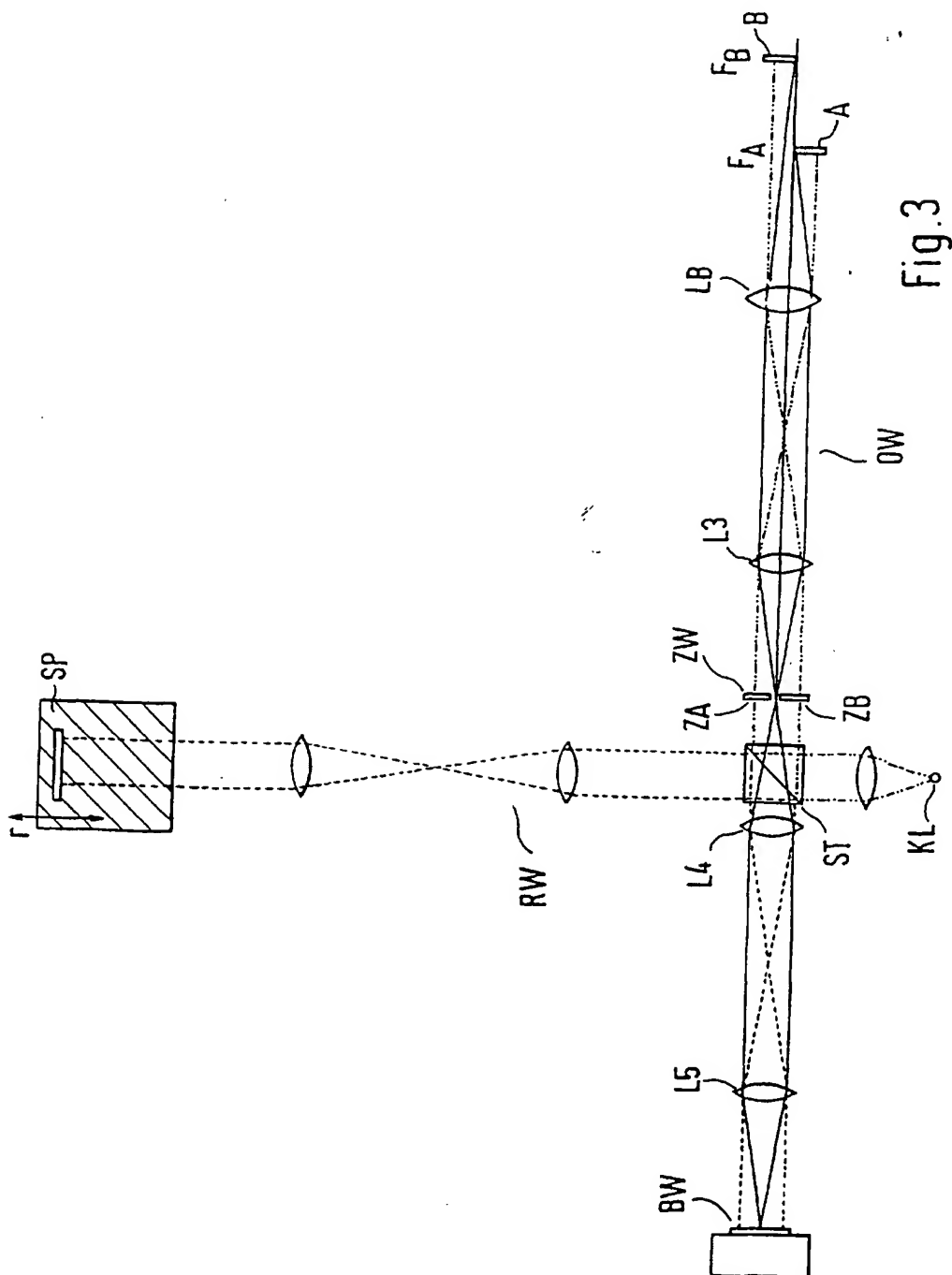


Fig. 2





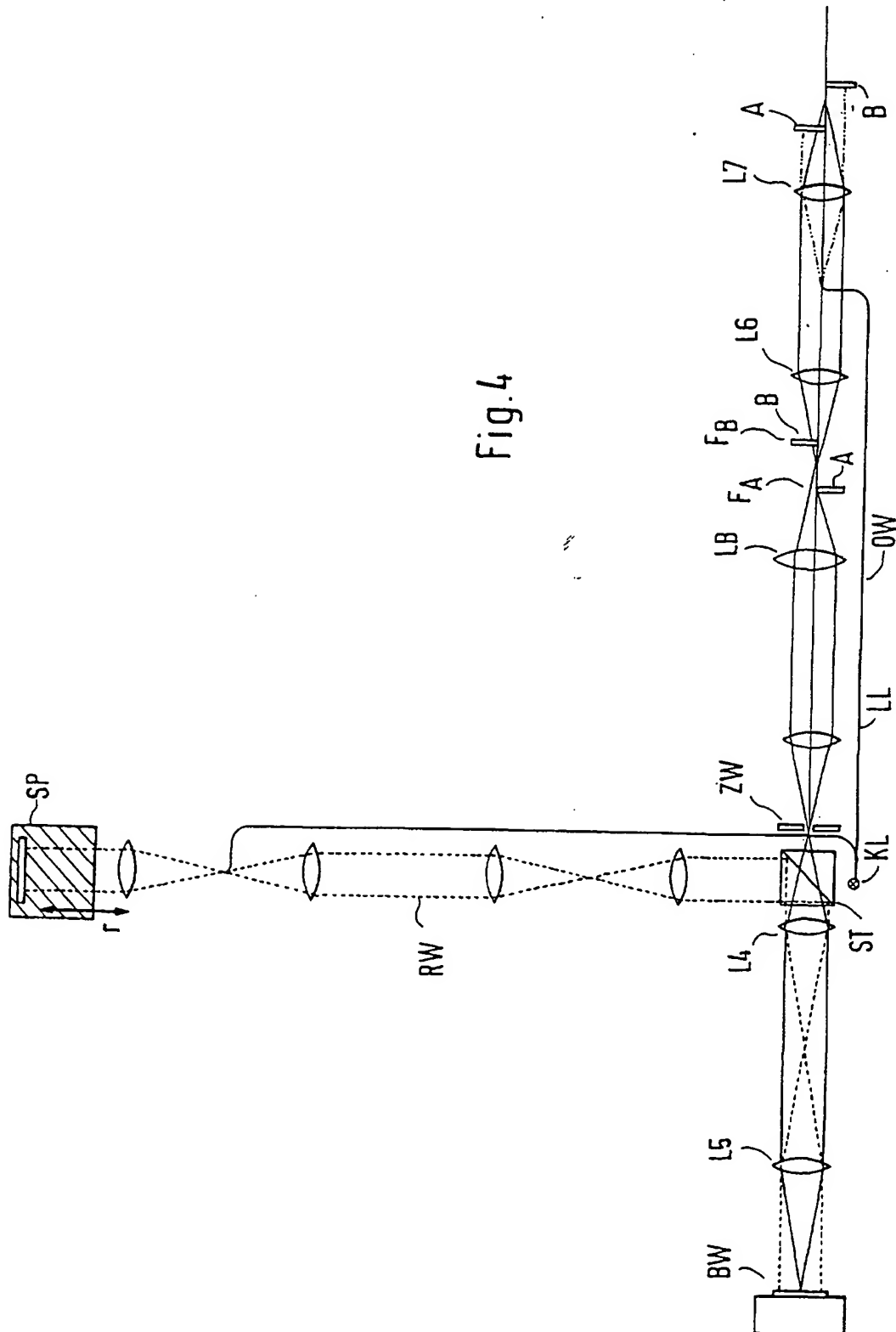


Fig. 4

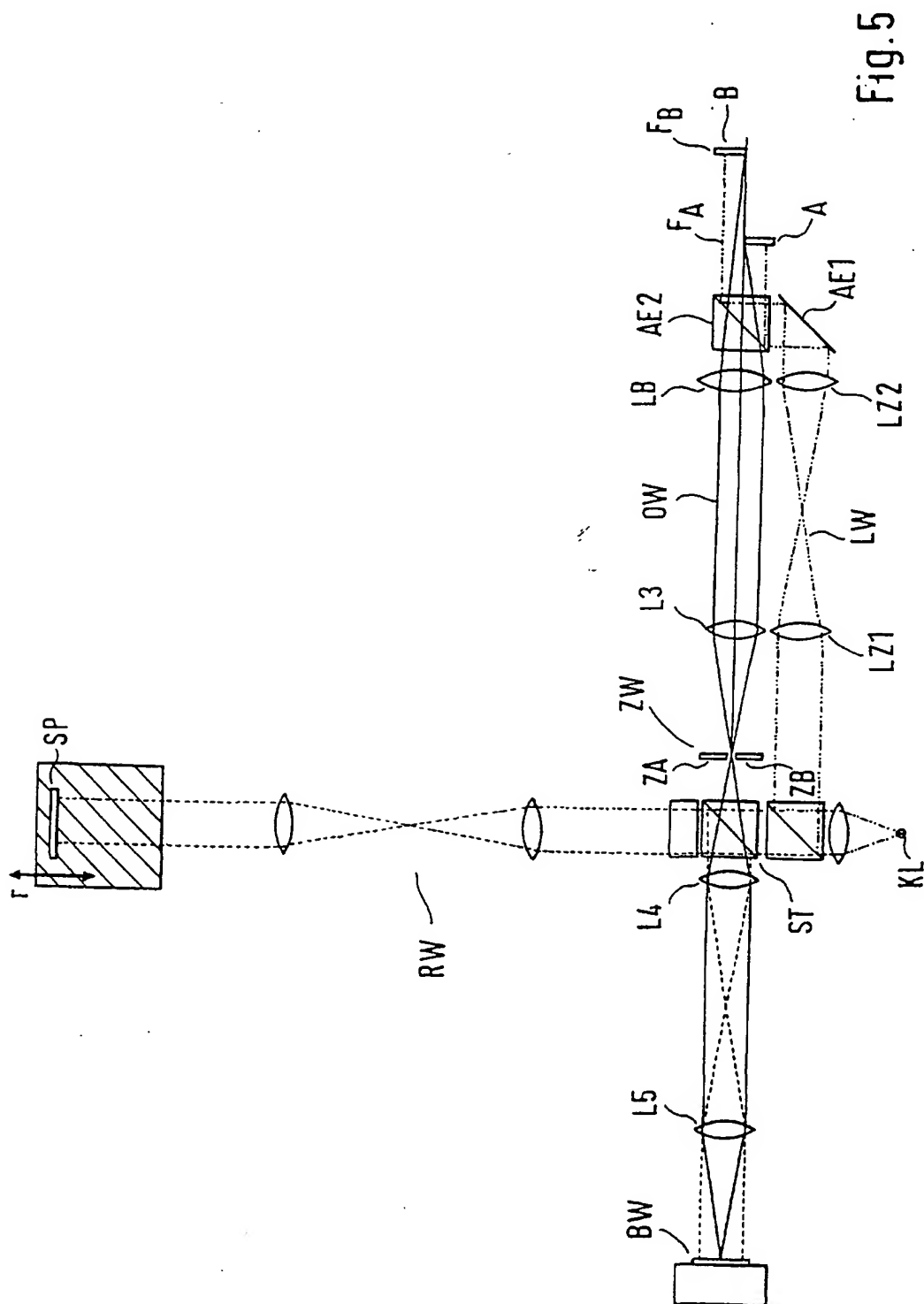


Fig. 5